

ОСОБЕННОСТИ ВАХ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР Al-Al₂O₃-МЕТАЛЛ

АЛЕКПЕРОВА Ш.М., ГАДЖИЕВА Г.С., АХМЕДЗАДЕ Р.Г.,
АХМЕДОВ И.А. АБДУЛ-ЗАДЕ Н.Н.

Институт Физики НАН Азербайджана

Исследовано влияние природы материала верхнего электрода на ВАХ тонкопленочных структур Al-Al₂O₃-M (M= Ag, Al, In, Cu, Sn). Показано, что в зависимости от материала верхнего электрода наблюдаются ВАХ с отрицательным сопротивлением N - и S- типов, а также характеристики типичные для варисторов.

Ранее [1] нами были изучены явления переключения и переноса в тонкопленочной структуре Al-Al₂O₃-Ag, на ВАХ которой была обнаружено отрицательное сопротивление (ОС) N-типа и следующее за ним S-типа (рис.1).

В настоящей работе исследуется влияние природы материала верхнего электрода на ВАХ тонкопленочных структур Al-Al₂O₃-металл. Исследуемые структуры на ситалловой подложке изготавливались термическим напылением алюминия в вакууме $\sim 5 \cdot 10^{-5}$ мм.рт.ст. Окисный слой алюминия (Al₂O₃) толщиной 30-60 Å получен экспонированием напыленного алюминия при нагреве подложки. Затем на этот слой наносился верхний электрод из различных металлов (Ag, Al, In, Cu, Sn). ВАХ структур осциллографировались на харктериографе ПНХТ-1.

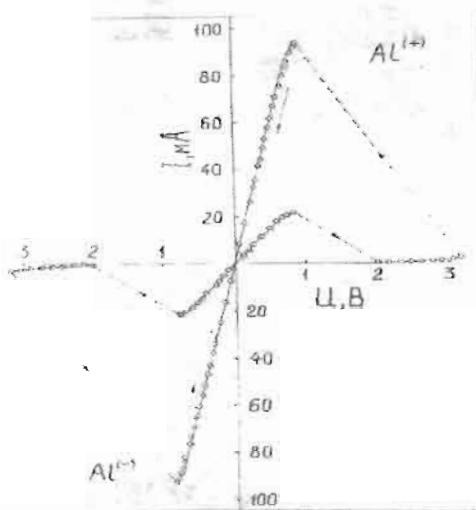


Рис.1. Статическая ВАХ структуры
Al-Al₂O₃-Ag при комнатной температуре

На рис.2 приведены осциллограммы ВАХ исследуемых структур Al-Al₂O₃-M при комнатной температуре. Видно, что характер ВАХ зависит от металла, образующего контакт с пленкой Al₂O₃. Так, на образцах с верхним электродом из серебра на ВАХ наблюдаются отрицательное сопротивление N-типа и следующее за ним S-типа (рис.1 и рис.2, а). На образцах с верхним электродом из индия (рис.2, в) и олова (рис.2, д) в основном получались характеристики варисторного типа. В структурах с алюминиевым (рис.2, б) и медным электродами (рис.2, г) наблюдались характеристики с эффектом переключения S-типа, отличающиеся от характеристик образцов с серебряным электродом отсутствием N-образного участка на ВАХ до переключения S-типа. В редких случаях на характеристиках образцов с алюминиевым верхним электродом наблюдался эффект переключения с несколькими участками отрицательного

сопротивления, что также видно из рис.2,б. Однако, на структурах с верхним электродом как из алюминия, так и из меди после нескольких измерений (10-15) наблюдались большие нестабильности рабочих характеристик и выход образцов из строя. Описанные характеристики имеют некоторое сходство с характеристиками тонкопленочных диодов на основе TiO_2 [2] и отличаются от характеристик диодов на основе Al_2O_3 [3, 4, 5],

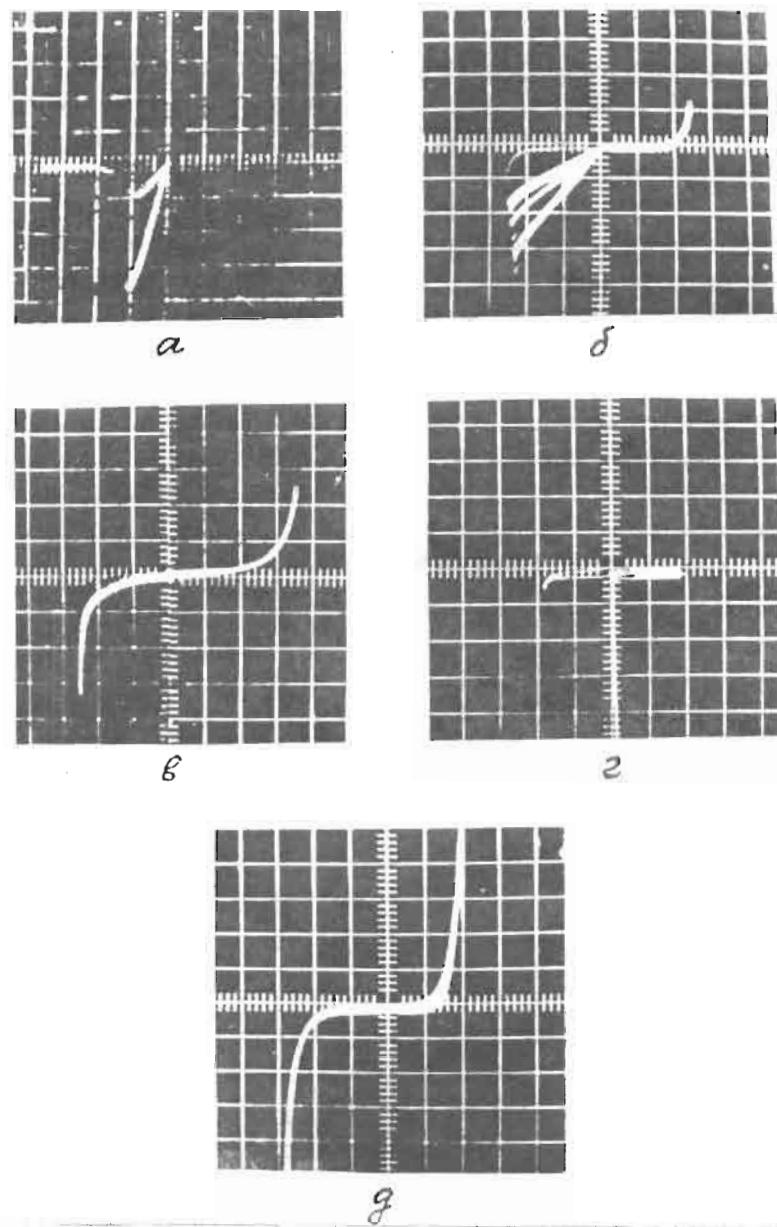


Рис.2. Осциллограммы ВАХ структур $Al-Al_2O_3-M$ с верхним электродом из Ag(а), Al(б), In(в), Cu(г), Sn(д), масштаб: U-1 В/дел, I- 20 мА/дел для структуры $Al-Al_2O_3$ -Ag и U - 2В/дел, I - 0,1mA/дел для остальных структур.

полученных с использованием различных верхних электродов. Во всех исследованных нами образцах наблюдалось изменение тока со временем, если они выдерживались под напряжением. Причем, при отрицательном нижнем электроде происходило увеличение, а при положительном - уменьшение тока со временем примерно с одинаковой инерционностью. Наблюдаемые изменения были обратимыми – первоначальные значения токов восстанавливались при перемене полярности

напряжения. Время таких изменений колеблется в пределах от нескольких секунд до нескольких минут.

Следует отметить что, характеристики структур с верхним электродом из индия (рис.2,в) и олова (рис.2,д) не симметричны относительно полярности приложенного напряжения: для получения одного и того же тока в разных направлениях требуется разные значения напряжения.

Из анализа ВАХ структур в рамках существующих теорий установлено, что токопрохождение через них обусловлено как туннельным эффектом, так и эффектом Шоттки.

Определены высоты потенциальных барьеров, которые оказались равными $\Phi_1 \approx 0,73$ эВ на границе Al-Al₂O₃ и $\Phi_2 \approx 0,53; 0,79; 0,97; 1,1; 1,12$ эВ на границе Al₂O₃ с In, Ag, Al, Sn, Cu соответственно.

Определена также эффективная масса электронов в Al₂O₃ ($m^* \approx 1,62m_0$),

Установлено, что переключение N-типа инициировано захватом электронов на ловушки, расположенные в запрещенной зоне Al₂O₃, а S-типа – туннелированием электронов из валентной зоны окисла и ловушечных уровней в металлический электрод под действием сильного электрического поля.

-
- [1] Ш.М.Алекперова, В.А.Бетхов, Г.С.Гаджиева, Ф.Д.Касимов, В.М.Мамиконова. Радиотехника, N 2, 32, 1986.
 - [2] Г.И.Черкашин, И.И.Лонкевич, В.И.Стafeев, М.С.Лурье. В сб. Физика р-п- переходов. Рига, «Зинате», 408, 1966
 - [3] R.M.Handy. Phys.Rev., 126, 6, 1968, 1962
 - [4] Г.А.Филаретов, В.И.Стafeев, Г.И.Черкашин, М.С.Лурье, Ю.З.Бубнов, Ж.С.Аснина. Радиотехника и электроника, 11, N 2, 298, 1966.
 - [5] C.Barriac, P.Pinard, F.Davoine. Phys Status Solidi, 34,2,621,1969

NAZIK TƏBƏQƏLİ AI-AL₂O₃-METAL STRUKTURLARININ VAX-NIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

ƏLƏKBƏROVA Ş.M., HACIYEVA G.S., ƏHMƏDZADƏ R.Q.,
ƏHMƏDOV İ.A., ABDUL-ZADƏ N.N.

Al-Al₂O₃-M (M= Ag, Al, In, Cu, Sn) strukturlarında yuxarı elektronun hazırlandığı materialın strukturun VAX-na təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, yuxarı elektronun hazırlandığı materialın təbiətiindən asılı olaraq strukturlarda N- və S-tipli mənfi müqavimətli və varistorlar üçün xarakterik olan xarakteristikalar müşahidə edilir.

THE PECULIARITIES OF UI CHARACTERISTICS OF AI-AL₂O₃-METALL STRUCTURES

ALEKBEROVA SH.M., GADIYEVA G.S., AHMEDZADE R.G.,
AHMEDOV I.A. ABDUL-ZADE N.N.

The influence of nature of upper electrode on the volt-ampere characteristics of thin-films structures Al-Al₂O₃-M (M= Ag, Al, In, Cu, Sn) has been investigated. The shape of the volt-ampere characteristics is shown to depend upon the nature at the upper electrode metal are established feature two regions of negative resistance N-type, S-type and characteristics of varistore type.